⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-50047

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)3月2日

H 01 L 23/46 H 02 M 1/00 Z-6835-5F Z-7154-5H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 半導体電力変換装置の冷却体

②特 頤 昭61-194685

建出 顧 昭61(1986)8月20日

四発 明 者 藤 堂 洋 子 東京都府中市東芝町1 株式会社東芝府中工場内 眀 邻発 者 井 \mathbf{B} 貞 夫 東京都府中市東芝町1 株式会社東芝府中工場内 79発明 老 渡 辺 榔 東京都府中市東芝町 1 株式会社東芝府中工場内 四発 明 者 H 辺 茂 東京都府中市東芝町1 株式会社東芝府中工場内

⑩出 願 人 株 式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 佐藤 一雄 外2名

明 和 田

1. 発明の名称

半導体電力変換装置の冷却体

2. 特許請求の範囲

半導体電力変換装置を構成するサイリスタ、抵抗体、リアクトル等の回路素子を冷却するための観響の冷却体において、冷却水と接触する冷却体内面に弱アルカリ性溶液により酸化酮皮膜が多なである防食皮膜を形成したことを特徴とする半導体質力変換装置の冷却体。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は電力変換装置の冷却体に係り、特に半導体素子により交直変換又は直交変換符を行う電力変換装置におけるサイリスタ、リアクトル、抵抗等の回路素子を冷却するための冷却体に関する。

(従来の技術)

通常、冷却体の材料としては、熱伝導率の大きな金配である金(Au)、貎(Ag)、銅(Cu)、アルミニウム(Al)などが適するが、変際にはそれらのうち安価な金品である朝(Cu)、アルミニウム(Al)、またはそれらを主成分とする合金が使われる。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、これらの金属からなる冷却体に 冷却水を流すと、冷却水中の存存酸素の働きによ り冷却水中に冷却体中の金属がアノード挤除する。 冷却体をたとえばCuにて形成した場合には、以 下の反応式にてアノード溶解が進行し、冷却休中 の類が溶解する。

C u → C u 11 + 2 0 -

4 e + 0 2 + 2 H 2 O - 4 O H

しかして、サイリスタ等の回路素子を複数値使用している場合には、冷却体を直列に多数観接続して使い、各冷却体は絶縁物からなる配水管接続したアノード溶解により冷却水中に溶けた金属イオン(例えばCu・・・)の一郎は、配水管の内面に付着する。そして、菱図の運転が長時間にわたると、配水管の絶縁低下を狙くとともに、管路损失が増加し冷却効率が低下するという問題点がある。

また、長期間の使用により冷却体中の金属の狩 解が続行すると、冷却体にピンホールが形成され

- 3 -

とができる。

(実施 例)

以下、木発明に係る半導体電力変換装置の冷却体の実施例を切1図乃至が5図を参照して説明する。

第1 図は、半導体電力変換装置を示すものであり、この半導体電力変換装置は半導体素子であるサイリスタS、低抗体R、リアクトルI. 等の回路 素子を備えており、これら回路素子はその内部抵抗のため稼動中に発験するため、それぞれ冷却体により冷却するようになっている。

上記サイリスタSを冷却する冷却体1は、駒製(Cu)の箱体からなり、又、抵抗体Rを冷却する冷却体4も銅製の箱体からなっている。上配冷却体1はその所面図が第2図に示されるように、 角筒状態面の冷却体本体2の内面に酸化銅皮膜3 を形成したものからなっている。また、冷如体4 も冷却体1と回様の構造であり、角筒状態面の冷 切体本体の内面に酸化銅皮膜を形成したものであ 冷却水が溢れる恐れがあるという問題点がある。

本発明は、上記事情に鑑みて別名されたもので、その目的とする処は、腐食による冷却水中への金属の溶解を防止することができる半導体電力変換 装岡の冷却体を提供することにある。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

上述した問題点を解決するための本発明は、半 難体電力 数換装置を構成する サイリスタ、 低気体、 リアクトル等の 回路 猴子を冷却するための 銅製の 冷却体において、冷却水と接触する冷却体内面に 弱アルカリ性溶液の化成処型により酸化網皮膜か らなる防食皮膜を形成したことを特徴とするもの である。

(作用)

木兒切は前記手段により、半導体電力変換装置の短路素子を冷却するための類裂の冷却体に、その内面に選アルカリ性水溶液を用いた化成処理により酸化類皮膜からなる防食皮膜を形成したため、腐食による冷却水内への金属の溶解を防止するこ

- 4 -

一方、リアクトルしを冷却する冷切体5は、その詳細図が第3図に示され、冷却体5は眩心 C上に螺旋状に巻回された頻製のパイプからなっている。この冷切体5は、その所面図が第4図に示されるように円筒状所面の冷却体本体6の内面に数化頻皮膜7を形成したものからなっている。

しかして、上記冷却体1、4、5はそれぞれ絶縁物からなる配水管8にて接続されており、冷却水は配水管入口8 JNから焼入し、冷却体1、4、5の内部を循環して配水で出口8 OUT から外部に設けるようになっている。即5、配水管入口の砂は、配水管8によりでは、配水管8によりでは、配水管8によりでは、配水での冷却体10、1c、10を検験する配水管8をで、冷却体はは、での冷却体48に旋数する。そしてかがははでの冷却に接続された冷却体4b、4cを介して配水管出口8 OUT とり外部に流出する。

次に、各冷却体1、4.5の内間に酸化酮皮膜

を形成する処理工程について第 5 図のプロック図をお照して説明する。

各処理工程は各冷却体 1 , 4 , 5 を直列に接続して、処理被を冷却体内面に循環させることにより行う。

- 7 -

(発明の効果)

4: 図面の簡単な説明

部1図は本発明に係る半単体を力を後装置の冷却体を適用した半導体を力を接装置の構成図、第2図は第1図に示すサイリスタの冷却体のⅡ-Ⅱ線に沿って切断した断面図、第3図は第1図のリアクトルの冷却体の拡大正面図、第4図は第3図の冷却体のIV-IV粒に沿って切断した断面図、第5図は本発明に係る冷却体の処理工程を示すプロ

2 Cu+NaClO₂ + 2 H₂ O→2 Cu (OH)₂ + NaCl 2 Cu (OH)₂ → 2 Cu O + 2 H₂ O 次に、水疣を十分行い(ステップ®)、退洗役 (ステップ®)、圧豁空気で乾燥する(ステップ

da) .

上記各処型工程を経て何材の冷却体の内面に延 塩素酸ナトリウムを主体とした処理液で産化網の 皮膜を形成する。第6図は従来の冷却体と、本発明に係る化成処理してその内面に酸化網の皮と 形成した冷却体との時間の軽過に伴なう酶Aの 強を示すものであり、周図において実験Aが 来の冷却体、破験Bが本発明の冷却体である。第 6図から明らかなように、本発明の冷却体は従来 の冷却体と比較して運転初期の験食速度は約10 分の1程度である。

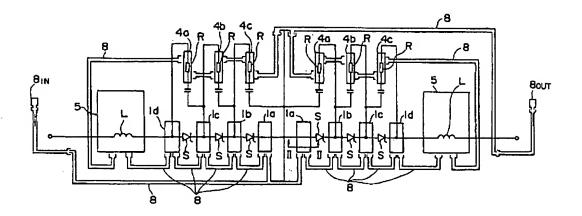
また、本発明の処理工程は前処理工程から本処理工程に至るまで処理被を循環させて行うため、処理工程が極めて簡便であり、めっきやプラスチックライニング等の他の処理法に比較して安価である。

- 8 -

ック図、第6図は従来の冷却体と本発明の冷却体の脳食速度の比較説明図である。

1 … サイリスタの冷却体、2 … 冷却体本体、3 … 酸化銅皮膜、4 … 冷却体、5 … 冷却体、6 … 冷却体、7 … 酸化銅皮膜、8 … 配水管。

出願人代迎人 佐 藤 一 雄



第 | 図

